

Inhalt

		Seite
<i>R. Feiertag</i>	Einführung	1
<i>W.G. Hertlein</i>	Lacke für die Maskentechnik mit kurzwelligem UV-Licht	5
<i>H. Letsche</i>	Die Grenzen der lichtoptischen Strukturabbildung	33
<i>P. Gerber und D. Sofronijević</i>	Anforderungen an die Maskentechnik für komplexe Bausteine mit Sub- μm -Strukturen	43
<i>Dr. Maul</i>	Molybdän-Silizid-Masken	61
<i>S. Kalbitzer</i>	Siliziummasken mit amorph-kristallinem Kontrast	71
<i>W. Schelb, W. Ehrfeld, D. Münchmeyer und H.J. Baving</i>	Beryllium-Masken für die Röntgenlithographie	85
<i>K.-H. Müller</i>	Grenzen der lichtoptischen Masken-Inspektion	105
<i>H. Wahlers</i>	Reparatur lichtoptischer Masken mit Ionenstrahlen	121
<i>U. Weigmann</i>	Reparatur von Röntgenmasken mit Ionenstrahlen	135
<i>L. Csepregi</i>	Maskenherstellung mit Hilfe der Mikromechanik	155
<i>R. Wijnaendts- van-Resandt und Dr. Ulrich</i>	Reticle-Herstellung mit Laser	169
<i>G. Bell</i>	Ein Plasmaätzgerät für die Maskentechnik	185